	科学研究費助成事業	研究成果報告書	KAKEN
		平成 27 年	₣ 6月10日現在
機関番号:	1 1 3 0 1		
研究種目:	挑戦的萌芽研究		
研究期間:	2012 ~ 2014		
課題番号:	2 4 6 5 6 0 2 7		
研究課題名	(和文)非線形誘電率顕微鏡を用いた原子双極子モー	メントの可視化と原子種の)同定
	(苗文)Visualization of atomic dipole moment an	d identification of ato	mic species by using
	scanning nonlinear dielectric microscopy		into spectes by using
研究代表者			
長 康雄	(Cho, Yasuo)		

東北大学・電気通信研究所・教授

研究者番号:40179966

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):本研究では非接触走査型非線形誘電率顕微鏡の高機能化・高性能化を図り,それを用いて様 々な材料の原子分解能計測を行い,原子種の同定も併せて行える事を目的とし,走査型非線形誘電率ポテンショメトリ の発明・開発,Si(111)面上で水素吸着サイトの同定,Si(100)面で酸素吸着サイトの同定と吸着のモデルの推定を行っ た.更にSiC上にためされたグラフェンのバッファ層とSiC間の外面状態を以上レスルで明らのにした.まだ限られたサ ンプル種ではあるが,原子種の同定及びそれらの基板との結合状態を明らかにする成果を得た.

研究成果の概要(英文):In this study, aiming the identification of atomic species by developing a highly functionalized and high performance scanning nonlinear dielectric microscopy (SNDM), we performed atomically resolved measurement for several materials. We measured hydrogen adsorbed Si(111) surface and oxygen absorbed Si(100) surface and succeeded to identify the adsorption site and to determine atomic structure of the site. We newly invented a new atomically resolved potentiometry named scanning nonlinear dielectric potentiometry (SNDP). Using this SNDP, we revealed the electronic state of interface between graphene and SiC substrate. These results show that SNDM and SNDP have a great potential to identify atomic spices on the surface of condensed matter and their bonding state to substrates.

研究分野: 誘電体工学

キーワード: 走査型非線形誘電率顕微鏡 走査型非線形誘電ポテンシ ョメトリ 原子双極子モーメント

3版

私石

1.研究開始当初の背景

走査型トンネル顕微鏡(STM)や非接触原子 間力顕微鏡(NC-AFM)は固体表面原子をリア ルスペースで観測できる画期的装置である が,観測している原子種を一般には同定でき ない.唯一の例外が NC-AFM を用いて Si.Pb.Sn の混合している系でシリコンティ ップと各原子の間に働く力の違いを理論的, 実験的に明らかにすることにより,各原子を 同定している報告があるのみである、この研 究成果は画期的なものであるが,実際には めから構成原子の種類とその割合が分かっ ており,特殊才能を持つ実験者による NC-AFM のオペレーションと,高級な理論 的計算も併せて行わなくてはならないなど, そのハードルは極めて高く現実に一般の研 究者が原子同定を行うことは不可能である。

また各原子が表面で待つ原子双極子モー メントの観測が直接行えるプローブ顕微鏡 技術は無かった.このような背景の中,本研 究者らは,まだが誘電計測により固体材料表 面の分極及び凹凸が原子スケールで観測で きる非接触型走査型非線形誘電率顕微鏡 (NC-SNDM)の開発に成功した.

本顕微鏡は原子双極子モーメントを直接 観測している可能性が非常に高く,その結果 原子種の簡単な同定にも大きな可能性を持 っている.

2.研究の目的

本研究では上記 NC-SNDM を用いて様々 な材料の原子分解能計測を行い,計測材料表 面での構成元素の凹凸と原子双極子モーメ ントを同時観測できる技術を確実なものと し,更に計測結果を分析できる技術を新たに 構築する.これらの結果を発展させ,原子種 の同定も同時に行える方法を確立する.

3.研究の方法

今回の研究目的を達成するため,まず現有 のアナログ走査方式の超高真空走査型非線 形誘電率顕微鏡をデジタルコントロール方 式に変更し,アトムトラッキングができる顕 微鏡に改造する.その結果単一原子上で様々 な次数の非線形誘電率信号が得られるよう になる.

次に元素を吸着させたサンプルを用い吸 着元素を原子毎に区別し.吸着サイトの双極 モーメントの違いによる分類を行う.

原子双極子モーメントのみが発生するポ テンシャルを原子分解能で分別的に定量的 に測定する新計測法を開発する.

これらの成果を応用し,幅広い材料の原子 双極子モーメントの測定を行う.更にこれを 発展させ NC-SNDM ならではの特長を生か した原子双極子モーメントの計測から界面 の原子状態の同定まで一貫して行える全く 新しい計測法の確立を行う.

4.研究成果

(1) NC-SNDM は高次非線形誘電計測から原子 の位置を検出し更に最低次非線形誘電計測 で誘電分極(今回議論する領域では原子双極 子モーメント)を計測するが,今回は特に一 つの原子を特定して非線形誘電率信号を取 得できるようにするためにこのため現有の アナログ式顕微鏡コントローラをデジタル 化する改造を行った.この結果プローブティ ップをベクトルスキャンできるようにした. 上で整備した,デジタル方式でプローブティ ップの位置を任意にコントロールできる超 高分解能・走査型非線形誘電率顕微鏡に,計 測中の画像のドリフトの抑制並びに単一原 子の長時間観測のためのアトムトラッキン グ法技術を付加した.

(2) 超高真空・高分解能・走査型非線形誘電 率顕微鏡を用い,まずその性能評価のため 水素を付加した Si(111)面7x7構造を作製 しその表面の観測を行った.その結果,Siア ドアトム上のダングリングボンドに水素原 子を吸着しこれによりアドアトム周辺の電 荷分布が対称となりアドアトム上の双極子 モーメントが消失した.これを実証した結果 が図1であり,同図(a)より水素吸着が起こ ってもε(4)信号がその起源である凹凸像には 大きな変化は見られず総ての7x7 構造のアド アトムが観測されているが,同図(b)のε(3) による双極子モーメント像では水素が吸着 したアドアトムの双極子モーメントがほぼ 0となっていることが分かる.以上のように, 単一原子の原子双極子モーメントの変化を 実験的に検証した.



5nm

図1水素原子吸着 Si(111)面 7x7 構造の(a) 凹凸像と(b)双極子モーメント像.(c)凹凸像 のラインプロアファイル(d)双極日モーメン ト像のラインプロファイル.

また平均トンネル電流と双極子モーメント 信号が関連あることを見出した.

(3)上記の基礎研究を受けて NC-SNDM をベースにした表面電位の定量的測定手法
(Scanning Nonlinear Dielectric
Potentoimetory:SNDP)を提案し、その有効性を Si(111)-(7×7)表面における形状像と表面電位像の同時観察により実証した.本手法は、容量の電圧依存性を純電気的に測定す

る SNDM の特徴を活かした方法であり,静電 気的な力勾配の検出をベースとして接触電 位差を定量化している既存の KPFM と異なり, 表面双極子に由来する局所表面電位を定量 できるユニークな手法として発展させられ る可能性を示した.



図 2 SNDP の動作原理

(4) SNDP の新領域への応用として、次世代の 超高速電子デバイスなどへの応用を目指し て近年盛んに研究されているグラフェンの 評価に関する研究を開始した.

4H-SiC(0001)基板上に形成された単層グ ラフェンの原子分解能像を得ることに成功 すると同時に,新規手法 SNDP を適用し,形 状像と表面電位分布の同時観察にも成功し た(図3参照).



図3.新開発 SNDP を用いた4H-SiC(0001)上 のグラフェンの原子分解能表面電位像(形状 に重ねて表示)

更に水素インターカレートした同グラフ ェン/SiC 界面を研究し,水素インターカレー ションすると界面基板 バッファ層間の共 有結合が切れ,界面の双極子モーメントを失 い表面電位が0になる事及びSiC 基板からの 拘束がなくなりSi-C 結合距離ほど表面の単 層グラフェンが浮き上がり平坦になる事な ど多くの重要な発見した.



図4 .SNDP を用いた水素インターカレートし たグラフェン/SiC の表面電位像(形状に重ね て表示)

(5)また,走査型非線形誘電率ポテンショメ トリ法(SNDP)の理論解析を行い本手法が KPFMとは異なり,双極子モーメント由来の電 位だけに感度があり,表面電荷や,接触電位 差(CPD)には影響を受けないことを明らかに した.(表1)

	KPFM (Ketvin Probe Force Microscopy)	SNDP	
feedback	electrostatic force $E_{gap} = 0$	capacitance variation $P = 0 (\partial C / \partial V \text{ or } \epsilon_3 = 0)$	
dipole sensitive	Yes	Yes	
fixed charge sensitive	Yes	No	
CPD sensitive	Yes	No	

表1 KPFM と SNDP の検出可能物理量の比較

(6)最後に酸素吸着 Si (100)面の観測を行い, 酸素が吸着したサイトが発生する双極子モ ーメント像と凹凸像(共に原子分解能)から 酸素の吸着の仕方が明らかに出来た.これは 原子種の同定につながる成果である.



図5酸素吸着 Si(100)-(2x1)表面の NC-SNDM 像.(a)凹凸像(b)双極子モーメント像(c) 酸 素吸着前のダイマーのモデル.(d)酸素吸着 後のダイマーのモデル.

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計10件) R. Takahashi,<u>Y. Cho</u>, M. Lippmaa: " Interfacial capacitance between a ferroelectric Fe304 thin film and a semiconducting Nb:SrTiO₃ ubstrate", J. Appl. Phys., 査読有, Vol.117, 2015, 14104.-1-10 DOI: 10.1063/1.4905384

Satoshi Inoue, Tomoki Ariga, Shin Matsumoto, Masatoshi Onoue, Takaaki Miyasako, Eisuke Tokumitsu, Norimichi Chinone, <u>Yasuo Cho</u>, Tatsuya Shimoda, " Investigation of solution-processed bismuth-niobium- oxide films ", J. Appl. Phys., 査読有, Vol.116, 2014, 154103-1-6 DOI: 10.1063/1.4898323

Kohei Yamasue, Masayuki Abe, Yoshiaki Sugimoto, <u>Yasuo Cho</u>: "Atomic-dipole -moment induced local surface potential on Si(111)-(7×7) surface studied by non-contact scanning nonlinear dielectric microscopy ", Appl. Phys. Lett., 査読有, Vol.105, 2014, 121601-1-5 DOI: 10.1063/1.4896323

Masataka Suzuki, Kohei Yamasue, Masayuki Abe, Yoshiaki Sugimoto, <u>Yasuo</u> Cho: " Improved study of electric dipoles on the Si(100)-2×1 surface by non-contact scanning nonlinear dielectric microscopy", 査読有,Vol.105, 2014, 101603-1-3 DOI: 10.1063/1.4895031

N. Chinone, T.Nakamura, <u>Y. Cho</u>: " Cross-sectional dopant profiling and depletion layer visualization of SiC power double diffused metaloxide-semiconductor field effect transistor using super-higher-order nonlinear dielectric microscopy", J. Appl. Phys., 査読有, Vol.116, 2014, 084509-1-7 DOI: 10.1063/1.4893959

Seungbum Hong, Sheng Tong, Woon Ik Park, Yoshiomi Hiranaga, <u>Yasuo Cho</u>, Andreas Roelofs; "Charge gradient microscopy", Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 査読有, Vol.111,2014, 6566-6569 DOI: 10.1073/pnas.1324178111

Yasuo Cho: "Electrical conduction in nanodomains in congruent lithium tantalate single crystal ", Appl. Phys. Lett., 査読有, Vol.104,2014 DOI: 10.1063/1.4863754

Daisuke Mizuno, Kohei Yamasue, <u>Yasuo</u> <u>Cho</u>: "Atomic dipole moment distribution on a hydrogen-adsorbed Si(111) - (7× 7) surface observed by noncontact scanning nonlinear dielectric microscopy", Appl. Phys. Lett., 査読 有, Vol.103, 2013, 101601-1-5 DOI: 10.1063/1.4820348

Kohei Yamasue, <u>Yasuo Cho</u>: " Simultaneous measurement of tunneling current and atomic dipole moment on Si(111)-(7×7)surface by noncontact scanning nonlinear dielectric microscopy "J. Appl. Phys., 査読有, Vol.113,2013, 014307-1-8 DOI: 10.1063/1.4772705

Koichiro Honda, <u>Yasuo Cho</u>: "Scanning nonlinear dielectric microscopy observation of accumulated charges in metal-SiO2-SiNSiO2-Si flash memory by detecting higher-order nonlinear permittivity", Appl. Phys. Lett.,査 読有, Vol.101,2012, 242101-1 -5 DOI: 10.1063/1.4769352

[学会発表](計8件) Kohei Yamasue, Hirokazu Fukidome, Kazutoshi Funakubo, Maki Suemitsu, Yasuo Cho: " Comparative Study on Pristine and Hydrogen-Intercalated Graphene on 4H-SiC(0001) Surface Using Noncontact Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy ", 2014 MRS fall meeting (Boston, U.S.A.), Dec. 2 2014

Masataka Suzuki, Kohei Yamasue, Masayuki Abe, Yoshiaki Sugimoto, <u>Yasuo</u> <u>Cho</u>: "Simultaneous Observation of Topography and Electric Dipole Moments on Si(100)-2×1 Surface Using Non-Contact Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy, 2014 MRS fall meeting (Boston, U.S.A.), Dec. 1 2014

Kohei Yamasue, <u>Yasuo Cho</u>: "Surface potentiometry based on scanning nonlinear dielectric microscopy" NC-AFM 2014 (Tsukuba, Japan), Aug. 6 2014

Kohei Yamasue, Masayuki Abe, Yoshiaki Sugimoto, <u>Yasuo Cho</u>: "Site Specific Measurement of Atomic Dipole Moment Induced Local Surface Potentials on Si(111)-(7 \times 7) Surface by Noncontact Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy, 2013 MRS fall meeting (Boston, U.S.A.), Dec. 5 2013

Norimichi Chinone, Takashi Nakamura, Yasuo Cho: "High Resolution Visualization of Carrier Distribution in SiC-MOSFET Using Super-Higher-Order Nonlinear Dielectric Microscopy", 2013 MRS fall meeting (Boston, U.S.A.), Dec. 4 2013

Kohei Yamasue, Daisuke Mizuno, <u>Yasuo</u> <u>Cho</u>: "Bias voltage dependence of atomic dipole moment and topography on hydrogen-adsorbed Si(111)-(7×7) surface studied by noncontact scanning nonlinear dielectric microscopy", NC-AFM 2013 (College Park, Maryland, U.S.A.),Aug. 7 2013

Daisuke Mizuno, Kohei Yamasue, <u>Yasuo</u> <u>Cho</u>: "Non-contact Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy Studies of Atomic Dipole Moments on Hydrogen-adsorbed Si(111)-7×7 Surface ", 2012 MRS fall meeting (Boston, U.S.A.), Nov. 28 2012

Kohei Yamasue, <u>Yasuo Cho</u>: " Simultaneous imaging of current and local dipole moments of Si(111)- (7×7) surface by noncontact scanning nonlinear dielectric microscopy", 15th International Conference on non-contact Atomic Force Microscopy (Cesky Krumlov, Czech Republic), July 2 2012

[図書](計2件) Shin-ichiro Kobayashi, <u>Yasuo Cho</u>: SMITHERS RAPRA TECHNOLOGY LTD., Innovative Graphene Technologies: Evaluation and Applications Volume 2, 2013, pp. 27-90

<u>長康雄</u>,オーム社,マイクロビームア ナリシス・ハンドブック,2014,221

〔その他〕 ホームページ等 http://www.tsc-web.jp/salon/Alaysis_Sal oon_7_SNDM.pdf

http://www.d-nanodev.riec.tohoku.ac.jp/

6.研究組織 (1)研究代表者 長 康雄(CH0, Yasuo) 東北大学・電気通信研究所・教授 研究者番号:40179966